（五）　マスク、レチクル又はペリクルの検査装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の1及び2に該当するもの
1　分解能が〇・二五マイクロメートル以下のもの
2　一軸又は二軸の座標上における六三・五ミリメートル以上の距離において、位置決め精度の絶対値が〇・七五マイクロメートル以下のもの
（六）　ウエハー製造用の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1　二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
2　位置決め精度の絶対値が〇・二五マイクロメートル（平均値に三シグマを加えたもの）未満のもの
3　機械間の重ね合わせ精度の絶対値が〇・三マイクロメートル以上のもの
4　光源の波長が四〇〇ナノメートル未満のもの
（七）　電子ビーム装置、イオンビーム装置及びエックス線装置であって、二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
（八）　レーザー発振器を用いた装置のうち、ウエハーに直接描画方式で二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
ハ　集積回路の組立用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
（一）　プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、次の1から3までの全てに該当するもの
1　ハイブリッド集積回路のために特に設計したもの
2　縦軸及び横軸に沿って三七・五ミリメートルを超えた移動ができるステージを有するもの
3　縦軸及び横軸に沿った面における配置の精度の絶対値が一〇マイクロメートル未満のもの
（二）　プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、一回の動作で二以上の結線を行うことができるもの
（三）　パッケージのキャップを当該パッケージのキャップ以外の部分より高い温度に加熱できる装置のうち、次の1から3までの全てに該当するもの
1　半自動又は全自動のもの
2　毎分一パッケージ以上処理できるもの
3　貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当するセラミック集積回路のパッケージ用に特に設計したもの
ニ　空気中における径が〇・三マイクロメートル以下の粒子の数を〇・〇二八三二立方メートル当たり一〇個以下とすることができるクリーンルーム用のフィルター及びその材料

第五条　輸出令別表第二の三第二号ホに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一　第一条又は貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管及び光学素子並びにこれらの部分品の検査又は試験のために特に設計した装置
二　半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品のために特に設計した試験装置及び検査装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置
イ　処理済みウエハー及び基板（プリント基板又はチップを除く。）の内部又は表面の〇・六マイクロメートル以下の欠陥、エラー又は汚損を自動的に検出するためのプログラム内蔵方式の検査装置であって、パターン比較のための画像の取得技術を用いたもの
ロ　プログラム内蔵方式の測定及び分析装置であって、次のいずれかに該当するもの
（一）　半導体物質中の酸素又は炭素の含有量の測定用に特に設計したもの
（二）　線幅の測定用のものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの
（三）　一〇マイクロメートル以下の平面度の測定用に特に設計したものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの
ハ　プログラム内蔵方式のウエハープロービング試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
（一）　位置決め精度の絶対値が三・五マイクロメートル未満のもの
（二）　端子数が六八を超える半導体素子及び集積回路を試験できるもの
（三）　一ギガヘルツを超える周波数で試験できるもの
ニ　試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
（一）　半導体素子及びパッケージに封入されていないダイの試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、一八ギガヘルツを超える周波数で試験ができるもの
（二）　集積回路及びその組立品の試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当する試験ができるもの
1　二〇メガヘルツを超えるパターンレートで実施するもの
2　一〇メガヘルツ超二〇メガヘルツ以下のパターンレートで実施するものであって、端子数が六八を超えるパッケージを対象とするもの
（三）　一、二〇〇ナノメートルを超える波長でフォーカルプレーンアレーの性能を評価するために特に設計したもののうち、電子計算機による評価又はプログラム内蔵方式による評価を用いるものであって、次のいずれかに該当するもの
1　直径〇・一二ミリメートル未満の走査光スポットを用いるもの
2　光感度性能パラメータの計測用及び周波数応答、変調伝達関数、応答の均一度又はノイズの評価用に設計したもの
3　縦三二ライン画素、横三二ライン画素を超える画像を生成することができるアレーを評価するために設計したもの
ホ　レーザーシステム及び三キロエレクトロンボルト以下のエネルギーで動作するために設計した電子ビーム試験装置であって、通電状態の半導体素子を非接触のプローブで検査するためのもののうち、次のいずれかに該当するもの
（一）　ビームブランキング又は検出器を用いたストロボ機能を有するもの
（二）　電圧測定用の電子分光計であって、分解能が〇・五ボルト未満であるもの
（三）　集積回路の性能を解析するための電気試験用のもの
ヘ　マスク又は半導体素子の製造、修理、物理的レイアウト解析及び試験を行うことができるように特に設計した多機能式の集束イオンビーム装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の（一）及び（二）に該当するもの
（一）　目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの
（二）　デジタルアナログ変換精度が一二ビットを超えるもの
ト　レーザー発振器を用いた粒度測定装置であって、空気中の粒子の径及び分布を測定するために設計したもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの
（一）　〇・〇二八三二立方メートル毎分以上の流速で〇・二マイクロメートル以下の粒子径を測定できるもの
（二）　国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ一四六四四―一で定めるクラス四又はそれ以上の空気清浄度を測定できるもの